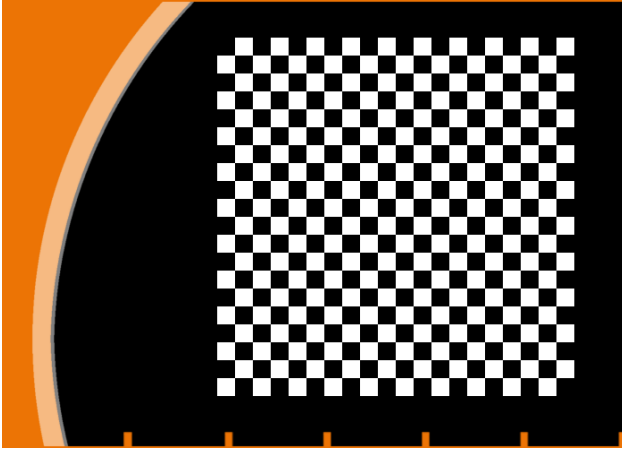


Schachbrettmuster TC-CB50

Schachbrett mit $50 \times 50 \mu\text{m}^2$ Quadraten



Dieses $9.0 \times 9.0 \text{ mm}^2$ große Schachbrettmuster aus quadratischen $50 \times 50 \mu\text{m}^2$ Feldern eignet sich insbesondere für die Prüfung von Verzeichnung und Bildfeldwölbung. Die sehr scharfen Kanten eignen sich aber auch zur Bestimmung der lokalen Abbildungsqualität.

(Abbildung schematisch)

Unsere hochauflösenden Testcharts sind mit hochpräziser E-Beam-Lithographie hergestellt. Als Träger dient ein Quarzsubstrat mit breiter spektraler Transmission (DUV-VIS-NIR), auf das eine Chromschicht hoher optischer Dichte aufgetragen ist. Die Teststrukturen werden durch die Abtragung der Chromschicht erzeugt, wobei Strukturgrößen bis zu 100 nm möglich sind und eine exzellente Maßhaltigkeit und Geradheit der Strukturkanten gewährleistet ist.

Substrat	Quarzwafer (Fused Silica), 10 mm x 10 mm x 1 mm
Träger	Objekträger-Format 75 mm x 25 mm x 1.5 mm, Edelstahl mit Lasergravur
Strukturierte Schicht	Chrom, optische Dichte OD > 8@400 nm / 6@550 nm / 4.5@750 nm / 3.6@1 μm
Pinhole-Abstufung (Durchmesser)	Schachbrettmuster $9.0 \times 9.0 \text{ mm}^2$ bestehend aus 180x180 Feldern der Größe $50 \times 50 \mu\text{m}^2$
Maßhaltigkeit (max. Absolutfehler)	100 nm/cm = 10^{-5}
Spektraler Transmissionsbereich	200 nm – 2000 nm